

SP-31000R



・特徴

成膜室が大きく、小物基材への成膜を目的とした中量産用装置です。基板取付台は公転と自転が個別に動作でき、任意のターゲット上で自転だけの操作も可能です。ターゲットに対する基板の傾き角も変えることが可能で、強い異方性スパッタリングが出来ます。

・仕様

到達圧力	$\times 10^{-5}$ Pa 台※常温・無負荷・脱ガス時
排気速度	$\times 10^{-4}$ Pa 台迄 15 分以内※常温・無負荷・脱ガス時
成膜室径	$\phi 700\text{mm} \times 400\text{mmH}$
スパッタ用電源	RF 電源 13.56MHz 1KW 自動マッチング 1 台
基板形状	$\phi 25\text{mm}$ 7 枚
膜厚分布	$\pm 15\%$ 以内
ターゲット寸法	4 インチ(金属・絶縁物)
ターゲット個数	3
基板回転	有り
基板加熱	常温 $\sim 250^{\circ}\text{C}$ 迄昇温可能
真空排気系	油回転ポンプ : 900L/min クライオポンプ : 1500L/sec
操作方法	自動
ガス系統	マスフローコントローラ 2 系統
ユーティリティ	電気 : AC200V 三相 15KVA 冷却水 : 10L/min 以上 0.1MPa 以上 0.15MPa 以下 25°C 以下循環 計装エア : 0.5MPa 以上 設置寸法 : 2500mmW \times 2000mmD \times 1800mmH